(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Januar 2003 (23.01.2003)

(51) Internationale Patentklassifikation7:

PCT

H01L 21/28,

Deutsch

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/007355 A3

21/8242, 21/768

(DE). WANG, Kae-Horng [—/DE]; Tieckstrasse 10, 01099 Dresden (DE).

PCT/EP02/07507 (21) Internationales Aktenzeichen:

(74) Anwälte: WILHELM, Jürgen usw.; Patentanwaltskanzlei, Wilhelm & Beck, Nymphenburger Strasse 139, 80636 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Juli 2002 (05.07.2002)

(81) Bestimmungsstaaten (national): KR, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache:

Veröffentlicht:

(30) Angaben zur Priorität: 101 33 873.2 12. Juli 2001 (12.07.2001)

mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 18. September 2003

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRÖNKE, Matthias [DE/DE]; Nordstrasse 8, 01099 Dresden (DE). STAUB, Ralf [DE/DE]; Ludwig-Jahn-Strasse 4, 01109 Dresden

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF CONTACTS FOR INTEGRATED CIRCUITS AND SEMICONDUCTOR COMPONENT WITH SAID CONTACTS

- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON KONTAKTEN FÜR INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND HALBLEITERBAUELEMENT MIT SOLCHEN KONTAKTEN
- (57) Abstract: The invention relates to the production of one (or several) contacts on one or several active areas of a semiconductor disk, whereby one or several insulated control lines can be arranged on the active areas to be contacted. The control lines can, for example, be gate lines. The semiconductor element is produced in the following manner: a polysilicon layer is deposited on the semiconductor disk, the polysilicon layer is structured in order to produce a polysilicon contact over the active area, whereby the polysilicon contact covers the two control lines in an at least partial manner, a first insulator layer is applied to the semiconductor disk incorporating said polysilicon contact, the first insulator layer is partially removed to reveal the covering surface of the polysilicon contact and a metal layer is applied to the semiconductor disk for the electrical contacting of the polysilicon contact.
- (57) Zusammenfassung: Es werden einen (oder mehrere) Kontakte auf einem oder mehreren aktiven Bereichen einer Halbleiterscheibe, wobei auf den zu kontaktierenden aktiven Bereichen eine oder mehrere isolierte Steuerleitungen angeordnet sein können, erzeugt. Bei den Steuerleitungen kann es sich beispielsweise um Gateleitungen handeln. Das Halbleiterbauelement wird wie folgt hergestellt: Aufbringen einer Polysiliziumschicht auf die Halbleiterscheibe, Strukturieren der Polysiliziumschicht, um einen Polysiliziumkontakt über dem aktiven Bereich zu erzeugen, wobei der Polysiliziumkontakt die beiden Steuerleitungen zumindest zum Teil überdeckt, Aufbringen einer ersten Isolatorschicht auf die Halbleiterscheibe unter Einbettung des Polysiliziumkontakts, teilweises Abtragen der ersten Isolatorschicht unter Freilegung der Deckfläche des Polysiliziumkontakts und Aufbringen einer Metallschicht auf der Halbleiterscheibe zur elektrischen Kontaktierung des Polysiliziumkontakts.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati al Application No PCT/EP 02/07507

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7. H01L21/28 H01L21/8242 H01L21/768

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01L} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 13, 30 November 1998 (1998-11-30) & JP 10 214949 A (TAIWAN MOSHII DENSHI KOFUN YUGENKOSHI), 11 August 1998 (1998-08-11) abstract	1-9
(US 6 174 782 B1 (LEE TONG-HSIN) 16 January 2001 (2001-01-16) figure 3A	1
A	US 6 159 808 A (CHUANG SHU-YA) 12 December 2000 (2000-12-12) column 4, line 33 - line 51; figures 2E,2F/	1-9

χ Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 26 February 2003	Date of mailing of the international search report 05/03/2003
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Le Meur, M-A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 02/07507

C.(Continue	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage	es Relevant to claim No.
- 3-11		
Α	US 6 083 803 A (FISCHER MARK ET AL) 4 July 2000 (2000-07-04) figure 16	1-9
A	US 6 180 453 B1 (SUNG JANMYE ET AL) 30 January 2001 (2001-01-30) column 3, line 22 - line 38	1-9
:		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 02/07507

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
JP 10214949	Α	11-08-1998	JP	2971411	B2	08-11-1999
US 6174782	B1	16-01-2001	TW	408446	В	11-10-2000
US 6159808	Α	12-12-2000	NONE			
US 6083803	Α	04-07-2000	AU JP TW WO US	2780199 2002505521 402786 9944232 6309973	T B A1	15-09-1999 19-02-2002 21-08-2000 02-09-1999 30-10-2001
US 6180453	B1	30-01-2001	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H01L21/28 H01L21/8242 H01L21/768

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 13, 30. November 1998 (1998-11-30) & JP 10 214949 A (TAIWAN MOSHII D KOFUN YUGENKOSHI), 11. August 1998 (1998-08-11) Zusammenfassung	ENSHI	1-9
X	US 6 174 782 B1 (LEE TONG-HSIN) 16. Januar 2001 (2001-01-16) Abbildung 3A		1
Α	US 6 159 808 A (CHUANG SHU-YA) 12. Dezember 2000 (2000-12-12) Spalte 4, Zeile 33 - Zeile 51; Ab 2E,2F	obildungen -/	1-9
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber i "E" älteres Anme "L" Veröffe schei ander soll o ausge "O" Veröffe eine i "P" Veröffe	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern m Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmani *Leveröffentlichung, die Mitglied derselbe 	ir zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindur ichung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindur keit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen R	echerchenberichts
2	26. Februar 2003	05/03/2003	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter Le Meur, M-A	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 02/07507

		PCT/EP 02/07507	
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Betr. Anspruch Nr.	
Α	US 6 083 803 A (FISCHER MARK ET AL) 4. Juli 2000 (2000-07-04) Abbildung 16	1-9	
A	US 6 180 453 B1 (SUNG JANMYE ET AL) 30. Januar 2001 (2001-01-30) Spalte 3, Zeile 22 - Zeile 38	1-9	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 02/07507

lm Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 10214949	Α	11-08-1998	JP	2971411 B2	08-11-1999
US 6174782	B1	16-01-2001	 TW	408446 B	11-10-2000
US 6159808	A	12-12-2000	KEIN	NE	
US 6083803	Α	04-07-2000	AU JP TW WO US	2780199 A 2002505521 T 402786 B 9944232 A1 6309973 B1	15-09-1999 19-02-2002 21-08-2000 02-09-1999 30-10-2001
US 6180453	B1	30-01-2001	KEI	NE	